

C10G 炭化水素油の分解；液体炭化水素混合物の製造，例．分解水添，オリゴメリゼーション，ポリメリゼーションによるもの（分解による水素または合成ガスの製造 C01B；炭化水素ガスの分解または熱分解による明確なまたは特定の組成の個々の炭化水素またはその混合物の製造 C07C；分解によるコークスの製造 C10B）；油頁岩，油砂またはガスからの炭化水素油の回収；主に炭化水素から成る混合物の精製；ナフサのリホーミング；鉱ろう [6]

注

(1) このサブクラスにおいては：

グルー - プ C10G9/00-C10G49/00 は単一工程に限定される。[3]

結合されたまたは多段階の工程はグルー - プ C10G51/00-C10G69/00 に包含される。[3]

鉱ろうの精製または回収はグルー - プ C10G73/00 に包含される。[3]

(2) このサブクラスにおいては，下記の用語または表現は以下に示す意味で用いる：

“水素の存在下”または“水素の不存在下”とは，それぞれ，水素が遊離の形でまたは水素発生化合物として添加されるか，または添加されない処理を意味する。[3]

“水素化処理”とはグルー - プ C10G45/00 またはグルー - プ C10G47/00 で定義される変換工程に対して使用される。[3]

“炭化水素油”とは炭化水素の混合物，例えばタール油または鉱油を含む。[3]

(3) このサブクラスにおいては，ラストブレイス優先ルールが適用される，すなわち各階層レベルにおいて相反する指示がない限り，分類は最後の適切な箇所に付与される。[3]

サブクラス内の索引

液体炭化水素混合物の製造..... 1/00-5/00,50/00
炭化水素油の精製..... 7/00
分解..... 9/00-15/00,47/00
炭化水素油の精製
酸またはアルカリを用いる処理による.. 17/00,19/00
溶剤または吸着性固体を用いる抽出による
21/00,25/00
水素との反応，酸化または他の化学反応による
27/00,29/00,45/00,49/00
他の工程..... 31/00,32/00,33/00
リホーミング..... 35/00,59/00-63/00
多段工程..... 51/00-69/00
他の工程..... 70/00,71/00
鉱ろうの処理..... 73/00
腐食防止..... 75/00
このサブクラスの他のグルー - プに分類されない主題事項
99/00

1/00 油頁（けつ）岩，油砂，非溶融性固形炭素質原料または類似の原料，例．木材，石炭，からの液体炭化水素混合物の製造（油頁岩，油砂またはその類似物からの油の機械的な取得 B03B）

- A 油頁岩，油砂等の液化
- B 廃棄物，都市ゴミの液化〔廃ゴム，廃プラスチックの液化 1/10〕〔廃棄物の焼却 F23G；熱交換 F28；汚泥処理 C02F11/00；固体物質からのガスの発生 C10J〕
- C 植物の液化〔炭素〕
- D 石炭の液化
- E ・前処理，スラリーの調製
- F ・脱水，乾燥〔スラリーの脱水〕
- G ・加熱，予熱

- H ・液化反応〔蒸留，乾留による液化 1/02，溶剤抽出 1/04，水添分解 1/06-1/08〕
- J ・液化反応生成物の分離精製〔固液分離，脱灰〕〔抽出，水添分解等からのもの〕
- K ・CFFC 法
- Z その他のもの

1/02

1/04

- ・蒸留による製造
- ・抽出によるもの
- A 使用する溶剤に特徴があるもの
- B ・超臨界ガス抽出
- C ・水
- Z その他のもの〔反応装置 1/06G-H〕

1/06

- ・分解水添によるもの

- A 溶剤
- B ・水添溶剤
- C ・EDS 法
- D 触媒
- E ・鉄を含有するもの
- F 還元性ガス
- G 反応装置〔触媒移動型，沸騰床型反応器 1/08〕
- H ・反応器への原料スラリーの圧入，反応生成物の排出
- Z その他のもの

1/08

1/10

2/00

3/00

- ・移動触媒によるもの
- ・ゴムまたはゴム廃物からの製造
- 炭素の酸化物からの組成の不明確な液体炭化水素混合物の製造 [5]
- 酸素含有有機原料，例．脂肪油，脂肪酸，からの液体炭化水素混合物の製造（非溶融性固形酸素含有炭素質原料からの製造 C10G1/00）
- B アルコール，エテルからの液体炭化水素混合物の製造
- Z その他のもの

5/00

5/02

5/04

5/06

7/00

7/02

7/04

7/06

7/08

- ガス，例．天然ガス，からの液体炭化水素混合物の回収
- ・固体吸着剤による回収
- ・液体吸収剤による回収
- ・冷却または圧縮による回収
- 炭化水素油の蒸留
- ・分留によるガスの除去でガソリンをスタビライズするもの
- ・脱水
- ・減圧蒸留 [3]
- ・共沸または抽出蒸留（水素の不存在下，選択溶剤を用いた抽出による炭化水素油の精製 C10G21/00）[3]
- ・蒸留の際の腐食の防止 [3]
- ・制御または調整 [3]

水素の不存在下における分解

9/00

9/02

9/04

9/06

9/08

9/12

9/14

- 炭化水素油の水素の不存在下における非接触的熱分解
- ・レトルト中におけるもの
- ・レトルト
- ・加圧蒸留によるもの
- ・そのための装置
- ・着あかの除去
- ・補助装置，例．ディジェスター，ソッキング・ドラム，膨張装置のあるまたはこれらのないパイプまたはコイルによるもの

9/16	・着あかの防止または除去	17/09	・酸塩を用いるもの [3]
9/18	・装置	17/095	・“ 固体酸 ”，例．担体上に沈積したりん酸，を用いるもの [3]
9/20	・・・チュ－ブ炉	17/10	・使用した精製薬剤の回収
9/24	・電気的手段で加熱するもの	19/00	アルカリ処理による，水素の不存在下における炭化水素油の精製
9/26	・不連続的に予熱された固定式固体材料，例．通気と運転，によるもの	19/02	・アルカリ性水溶液を用いるもの
9/28	・予熱された移動する固体材料によるもの	19/04	・・・溶解化剤，例．溶質化剤，を含有する溶液
9/30	・・・“ 移動床 ” 技術によるもの	19/06	・・・亜鉛酸塩または鉛酸塩によるもの
9/32	・・・“ 流動床 ” 技術によるもの	19/067	・溶融したアルカリ物質を用いるもの [3]
9/34	・不活性の予熱された流体，例．熔融金属または塩，との直接接触によるもの	19/073	・固体のアルカリ物質を用いるもの [3]
9/36	・・・加熱されたガスまたは蒸気との直接接触によるもの	19/08	・使用した精製薬剤の回収
9/38	・・・分解される材料の部分燃焼または他の炭化水素の燃焼によって製造されるもの [2]	21/00	選択溶剤を用いる抽出による，水素の不存在下における炭化水素油の精製（C01G17/00，C01G19/00 が優先）
9/40	・熱い燃焼ガス以外の予熱された流体との間接の接触によるもの	21/02	・別々に導入されるまたは除去される 2 種またはそれ以上の溶剤によるもの
9/42	・分解される材料を薄い流れまたはスプレ－にして連続的に加熱された表面上にまたはその近くに通すもの	21/04	・・・少なくとも 2 種の混和しない溶剤を互いに向流で同時に導入することによるもの
11/00	炭化水素油の水素の不存在下における接触分解（熔融金属または塩との直接接触による分解 C10G9/34）	21/06	・使用する溶剤によって特徴づけられるもの
11/02	・使用する触媒によって特徴づけられるもの	21/08	・・・無機化合物のみ
11/04	・・・酸化物	21/10	・・・二酸化硫黄
11/05	・・・結晶性アルミノけい酸塩，例．分子ふるい [3]	21/12	・・・有機化合物のみ
11/06	・・・硫化物	21/14	・・・炭化水素
11/08	・・・ハロゲン化物	21/16	・・・酸素含有化合物
11/10	・固定触媒床によるもの	21/18	・・・ハロゲン含有化合物
11/12	・不連続的に予熱された固定式固体触媒，例．通気と運転，によるもの	21/20	・・・窒素含有化合物
11/14	・予熱された移動する固体触媒によるもの	21/22	・・・硫黄，セレン，またはテルルを含有する化合物
11/16	・・・“ 移動床 ” 技術によるもの	21/24	・・・りん含有化合物
11/18	・・・“ 流動床 ” 技術によるもの	21/26	・・・けい素含有化合物
11/20	・不活性の加熱されたガスまたは蒸気との直接接触によるもの	21/27	・・・グル－ブ C10G21/14-C10G21/26 の単一のグル－ブに分類されない有機化合物 [3]
11/22	・・・分解される材料の部分燃焼により製造されるもの	21/28	・使用済み溶剤の回収
15/00	電気的方法，電磁的または機械的振動，粒子の放射または電弧中で過熱されたガスによる炭化水素油の分解	21/30	・制御または調整 [3]
15/08	・電気的方法または電磁的または機械的振動によるもの [3]	25/00	固体の収着剤を用いる水素の不存在下における炭化水素油の精製
15/10	・粒子の放射によるもの [3]	このグル－ブに分類するとき，クロマトグラフィ－に関する一般分野の主題事項が関係している限り，グル－ブ B01D15/08 にも分類する [8]	
15/12	・電弧，例．プラズマ，中で過熱されたガスによるもの [3]	25/02	・イオン交換物質を用いるもの
水素の不存在下における精製		25/03	・・・結晶性アルミノけい酸塩，例．分子ふるい，を用いるもの [3]
17/00	酸，酸生成化合物または酸含有液体，例．酸スラッジ，を用いる水素の不存在下における炭化水素油の精製	25/05	・・・非炭化水素化合物，例．硫黄化合物，の除去 [3]
17/02	・酸または酸含有液体，例．酸スラッジ，を用いるもの	25/06	・移動する収着剤または油中に分散した収着剤を用いるもの
17/04	・・・不混和の 2 相を形成する液 液処理	25/08	・・・“ 移動床 ” 技術によるもの
17/06	・・・いおうまたはいおうの酸スラッジから誘導される酸を使用するもの	25/09	・・・“ 流動床 ” 技術によるもの [3]
17/07	・・・ハロゲン酸またはハロゲンのオキシ酸を用いるもの（ハロゲンを生成する酸 C10G27/02）[3]	25/11	・・・移動する収着剤の存在下における蒸留 [3]
17/08	・酸生成酸化物を用いるもの（選択的溶剤として CO ₂ または SO ₂ を用いる精製 C10G21/06）	25/12	・使用済み吸着剤の回収
17/085	・・・発煙硫酸を用いるもの [3]	27/00	酸化による水素の不存在下における炭化水素油の精製
		27/02	・ハロゲンまたはハロゲン発生化合物によるもの；次亜塩素酸またはその塩
		27/04	・酸素または酸素発生化合物によるもの
		27/06	・・・アルカリ溶液の存在下に行なうもの
		27/08	・・・塩化銅の存在下に行なうもの

27/10	・金属含有有機錯体，例．キレ-ト，または陽イオン交換樹脂の存在下に行うもの [3]	35/085	・・・白金族金属またはそれらの化合物を含有するもの [3]
27/12	・酸素発生化合物，例．過化合物，クロム酸，クロム酸塩を用いるもの（亜鉛酸塩または鉛酸塩 C10G19/06） [3]	35/09	・・・金属の少なくとも 1 つが白金族金属である 2 元金属触媒 [3]
27/14	・オゾン含有ガスを用いるもの [3]	35/095	・・・結晶性アルミノけい酸塩，例．分子ふるい，を含有するもの [3]
29/00	他の化学薬品を用いる水素の不存在下における炭化水素油の精製	35/10	・移動する触媒を使用するもの
29/02	・非金属	35/12	・・・“移動床”技術によるもの
29/04	・金属，または担体上に沈積した金属	35/14	・・・“流動床”技術によるもの
29/06	・金属塩，または担体上に沈積した金属塩	35/16	・電氣的，電磁的，または機械的振動によるもの；粒子の放射によるもの
29/08	・低原子価における金属を含有するもの	35/22	・リホ-ミング操作の開始 [3]
		35/24	・リホ-ミング操作の制御または調整 [3]
29/10	・硫化物	水素化処理 [3]	
29/12	・ハロゲン化物 [3]	45/00	水素または水素発生化合物を用いる炭化水素油の精製 [3]
29/16	・金属酸化物	グル-プ 45/02,45/32,45/44 または 45/58 の単一のグル-プに分類されない水素発生化合物の存在下における炭化水素油の処理はグル-プ 49/00 に包含される。 [3]	
29/20	・金属原子を含有しない有機化合物	45/02	・含有炭化水素の骨格を変えることなく，かつ低沸点炭化水素に分解することなく，ヘテロ原子を除去するためのもの；ハイドロフィニッシング [3]
29/22	・唯一のヘテロ原子として酸素を含有するもの	45/04	・使用する触媒によって特徴づけられるもの [3]
29/24	・・・アルデヒドまたはケトン	A	形状、表面特性、多孔性に特徴を有するもの
29/26	・ハロゲン化炭化水素	B	再生、活性化、硫化処理
29/28	・唯一のヘテロ原子としていおうを含有するもの，例．メルカプタン，または唯一のヘテロ原子として硫黄および酸素を含有するもの	Z	その他のもの
31/00	他に分類されない方法による水素の不存在下における炭化水素油の精製（蒸留によるもの C10G7/00） [2]	45/06	・・・ニッケルまたはコバルト金属，またはそれらの化合物を含有するもの [3]
31/06	・加熱，冷却または圧力処理によるもの	A	形状、表面特性、多孔性に特徴を有するもの
31/08	・水で処理するもの	B	再生、活性化、硫化処理
31/09	・ろ過によるもの [3]	Z	その他のもの
31/10	・遠心力の助けによるもの	45/08	・・・クロム，モリブデン，またはタンゲステン金属，またはそれらの化合物と結合したものの [3]
31/11	・透析によるもの [3]	A	形状、表面特性、多孔性に特徴を有するもの
32/00	電氣的または磁氣的方法，照射または微生物を用いることによる炭化水素油の精製 [3]	B	再生、活性化、硫化処理
	A 微生物による炭化水素油の精製	Z	その他のもの
	Z その他のもの（超音波照射によるもの）	45/10	・・・白金族金属またはそれらの化合物を含有するもの [3]
32/02	・電氣的または磁氣的方法によるもの [3]	A	形状、表面特性、多孔性に特徴を有するもの
	A 電氣的方法	B	再生、活性化、硫化処理
	B 磁氣的方法	Z	その他のもの
	C 電氣的方法と磁氣的方法との併用	45/12	・・・結晶性アルミノけい酸塩，例．分子ふるい，を含有するもの [3]
	Z その他のもの	A	形状、表面特性、多孔性に特徴を有するもの
32/04	・粒子の放射によるもの [3]	B	再生、活性化、硫化処理
33/00	炭化水素油の脱水または抗乳化（蒸留によるもの C10G7/04）	Z	その他のもの
33/02	・電氣的または磁氣的方法によるもの	45/14	・移動する固体粒子を用いるもの [3]
33/04	・化学的方法によるもの	45/16	・・・油中に懸濁したもの，例．スラリー - [3]
33/06	・機械的方法によるもの，例．ろ過によるもの	45/18	・・・“移動床”技術によるもの [3]
33/08	・制御または調整 [3]	45/20	・・・“流動床”技術によるもの [3]
35/00	ナフサのリホ-ミング	45/22	・・・油中に溶解または懸濁した水素を用いるもの [3]
このグル-プにおいては，下記の用語は以下に示す意味で用いる：		45/24	・水素発生化合物を用いるもの [3]
“リホ-ミング”とはオクタン価またはその芳香族含量を改良するためのナフサの処理を意味する。 [3]		45/26	・・・水蒸気または水 [3]
35/02	・熱リホ-ミング		
35/04	・接触リホ-ミング		
35/06	・使用する触媒によって特徴づけられるもの		

45/28	…有機化合物；オ－トファイニング [3]	47/20	……他の金属またはそれらの化合物を含有する触媒 [3]
45/30	…使用する触媒によって特徴づけられるもの [3]	47/22	・水素の存在下における非接触的分解 [3]
45/32	・ジオレフィンまたはアセチレン化合物の選択的水添 [3]	47/24	・移動する固体粒子を用いるもの [3]
45/34	…使用する触媒によって特徴づけられるもの [3]	47/26	…油中に懸濁したもの，例．スラリー - [3]
45/36	…ニッケルまたはコバルト金属，またはそれらの化合物を含有するもの [3]	47/28	…“移動床”技術によるもの [3]
45/38	…クロム，モリブデンまたはタングステン金属，またはそれらの化合物と結合したもの [3]	47/30	…“流動床”技術によるもの [3]
45/40	…白金族金属またはそれらの化合物を含有するもの [3]	47/32	・水素発生化合物の存在下におけるもの [3]
45/42	…移動する固体粒子を用いるもの [3]	47/34	…有機化合物，例．水添した炭化水素 [3]
45/44	・芳香族炭化水素の水添 [3]	47/36	・制御または調整 [3]
45/46	…使用する触媒によって特徴づけられるもの [3]	49/00	グル－ブ C10G45/02, C10G45/32, C10G45/44, C10G45/58 または C10G47/00 の単一のグル－ブに分類されない水素または水素発生化合物の存在下における炭化水素油の処理 [3]
45/48	…ニッケルまたはコバルト金属，またはそれらの化合物を含有するもの [3]	49/02	・使用する触媒によって特徴づけられるもの [3]
45/50	…クロム，モリブデンまたはタングステン金属，またはそれらの化合物と結合したもの [3]	49/04	…ニッケル，コバルト，クロム，モリブデン，またはタングステン金属，またはそれらの化合物を含有するもの [3]
45/52	…白金族金属またはそれらの化合物を含有するもの [3]	49/06	…白金族金属またはそれらの化合物を含有するもの [3]
45/54	…結晶性アルミノけい酸塩，例．分子ふるい，を含有するもの [3]	49/08	…結晶性アルミノけい酸塩，例．分子ふるい，を含有するもの [3]
45/56	…移動する固体粒子を用いるもの [3]	49/10	・移動する固体粒子を用いるもの [3]
45/58	・存在する他の炭化水素を分解することなくある炭化水素成分の骨格構造を変化させるためのもの，例．流動点の低下；ノルマルパラフィンの選択的水素化分解（C10G32/00 が優先；ナフサのオクタン価または芳香族含量の改良または向上 C10G35/00）[3]	49/12	…油中に懸濁したもの，例．スラリー - [3]
45/60	…使用する触媒によって特徴づけられるもの [3]	49/14	…“移動床”技術によるもの [3]
45/62	…白金族金属またはそれらの化合物を含有するもの [3]	49/16	…“流動床”技術によるもの [3]
45/64	…結晶性アルミノけい酸塩，例．分子ふるい，を含有するもの [3]	49/18	・水素発生化合物，例．アンモニア，水，硫化水素，の存在下に行うもの [3]
45/66	…移動する固体粒子を用いるもの [3]	49/20	…有機化合物 [3]
45/68	…炭化水素油留分の芳香族化 [3]	49/22	・流出物の分離 [3]
45/70	…白金族金属またはそれらの化合物を含有する触媒を用いるもの [3]	49/24	・水素化処理操作の開始 [3]
45/72	・制御または調整 [3]	49/26	・制御または調整 [3]
47/00	低沸点の留分を得るための水素または水素発生化合物の存在下における炭化水素油の分解（C10G15/00 が優先；非溶解性固体炭素質または類似物質の分解水添 C10G1/06）[3]	50/00	炭素数がより少ない炭化水素からの液体炭化水素混合物の製造，例．オリゴメリゼーションによる [6]
47/02	・使用する触媒によって特徴づけられたもの [3]	50/02	・潤滑用炭化水素油の [6]
47/04	…酸化物 [3]	多段工程	
47/06	…硫化物 [3]	グル－ブ 51/00 から 69/00 は，その特徴点が各工程間の関係にある結合された処理操作のみを包含する。[3]	
47/08	…ハロゲン化物 [3]	51/00	2 以上の分解工程のみによる水素の不存在下における炭化水素油の処理 [3]
47/10	…担体上に沈積した触媒を用いるもの [3]	51/02	・連続工程のみによるもの [3]
47/12	…無機担体 [3]	51/04	…熱分解および接触分解工程のみを包含するもの [3]
47/14	…白金族金属またはそれらの化合物を含有する触媒 [3]	51/06	・並行工程のみによるもの [3]
47/16	…結晶性アルミノけい酸塩担体 [3]	53/00	2 以上の精製工程による水素の不存在下における炭化水素油の処理 [3]
47/18	…白金族金属またはそれらの化合物を含有する触媒 [3]	53/02	・連続工程のみによるもの [3]
		53/04	…少なくとも 1 つの抽出工程を包含するもの [3]
		53/06	…抽出工程のみを包含するもの，例．溶剤処理による脱アスファルトにひき続く芳香族成分の抽出 [3]
		53/08	…少なくとも 1 つの収着工程を包含するもの [3]
		53/10	…少なくとも 1 つの酸処理工程を包含するもの [3]
		53/12	…少なくとも 1 つのアルカリ処理工程を包含するもの [3]

53/14	・少なくとも1つの酸化工程を包含するもの [3]	67/06	・水素の不存在下における精製工程として収着工程を包含するもの [3]
53/16	・並行工程のみによるもの [3]	67/08	・水素の不存在下における精製工程として酸処理を包含するもの [3]
55/00	少なくとも1つの精製工程と少なくとも1つの分解工程とによる水素の不存在下における炭化水素油の処理 [3]	67/10	・水素の不存在下における精製工程としてアルカリ処理を包含するもの [3]
55/02	・連続工程のみによるもの [3]	67/12	・水素の不存在下における精製工程として酸化を包含するもの [3]
55/04	・少なくとも1つの熱分解工程を包含するもの [3]	67/14	・水素の不存在下における少なくとも2つの異なる精製工程を包含するもの [3]
55/06	・少なくとも1つの接触分解工程を包含するもの [3]	67/16	・並行工程のみによるもの [3]
55/08	・並行工程のみによるもの [3]	69/00	少なくとも1つの水素化処理工程と少なくとも1つの他の変換工程とによる炭化水素油の処理 (C10G67/00 が優先) [3]
57/00	少なくとも1つの分解工程または精製工程と少なくとも1つの他の変換工程とによる水素の不存在下における炭化水素油の処理 [3]	69/02	・連続工程のみによるもの [3]
57/02	・重合を伴うもの [3]	69/04	・少なくとも1つの水素の不存在下における接触分解を包含するもの [3]
59/00	2以上のリホ - ミング工程のみまたは少なくとも1つのリホ - ミング工程とナフサの沸点範囲を実質的に変化させない少なくとも1つの工程とによるナフサの処理 [3]	69/06	・少なくとも1つの水素の不存在下における熱分解を包含するもの [3]
59/02	・連続工程のみによるもの [3]	69/08	・少なくとも1つのナフサのリホ - ミング工程を包含するもの [3]
59/04	・少なくとも1つの接触のおよび少なくとも1つの非接触のリホ - ミング工程を包含するもの [3]	69/10	・高沸点留分のナフサへの水素化分解および得られたナフサのリホ - ミング [3]
59/06	・並行工程のみによるもの [3]	69/12	・少なくとも1つの重合またはアルキル化工程を包含するもの [3]
61/00	少なくとも1つのリホ - ミング工程と少なくとも1つの水素の不存在下における精製工程とによるナフサの処理 [3]	69/14	・並行工程のみによるもの [3]
61/02	・連続工程のみによるもの [3]	70/00	グル - プ C10G9/00, C10G11/00, C10G15/00, C10G47/00, C10G51/00 に包含される工程により得られた組成の不明確な通常ガス状の混合物の仕上げ処理加工 [5]
61/04	・精製工程が抽出であるもの [3]	70/02	・水素添加によるもの [5]
61/06	・精製工程が収着であるもの [3]	70/04	・物理的工程によるもの [5]
61/08	・並行工程のみによるもの [3]	70/06	・気体 液体接触によるもの [5]
61/10	・他の変換工程を包含する工程によるもの [3]	71/00	潤滑特性を改善するための炭化水素油または脂肪油の，他に分類されない方法による処理 [3]
63/00	少なくとも1つのリホ - ミング工程と少なくとも1つの他の変換工程とによるナフサの処理 (C10G59/00, C10G61/00 が優先) [3]	71/02	・ボルト - ル油化することによる増稠 (ボルト - ル油化による乾性油の化学的改質 C09F7/04) [3]
63/02	・連続工程のみによるもの [3]	73/00	鉱ろう，例．モンタンろう，の回収または精製 (本質的にろうを基剤とした組成物 C08L91/00) [3]
63/04	・少なくとも1つの分解工程を包含するもの [3]	73/02	・炭化水素油からの石油ろうの回収；炭化水素油の脱ろう [3]
63/06	・並行工程のみによるもの [3]	73/04	・ろ過器を使用するもの [3]
63/08	・少なくとも1つの分解工程を包含するもの [3]	73/06	・溶媒を使用するもの [3]
65/00	2以上の水素化処理のみによる炭化水素油の処理 [3]	73/08	・有機化合物 [3]
65/02	・連続工程のみによるもの [3]	73/10	・炭化水素 [3]
65/04	・精製工程のみを包含するもの [3]	73/12	・酸素含有化合物 [3]
65/06	・少なくとも1つの工程がジオレフィンの選択的水添であるもの [3]	73/14	・ハロゲン含有化合物 [3]
65/08	・少なくとも1つの工程が芳香族炭化水素の水添であるもの [3]	73/16	・窒素含有化合物 [3]
65/10	・分解工程のみを包含するもの [3]	73/18	・いおう，セレンまたはテルルを含有するもの [3]
65/12	・分解工程および他の水素化処理工程を包含するもの [3]	73/20	・りんを含有するもの [3]
65/14	・並行工程のみによるもの [3]	73/22	・有機化合物の混合物 [3]
65/16	・精製工程のみを包含するもの [3]	73/23	・使用済溶剤の回収 [6]
65/18	・分解工程のみを包含するもの [3]	73/24	・付加物の生成によるもの [3]
67/00	少なくとも1つの水素化処理工程と少なくとも1つの水素の不存在下における精製工程とによる炭化水素油の処理 [3]	73/26	・浮遊選別によるもの [3]
67/02	・連続工程のみによるもの [3]	73/28	・遠心力によるもの [3]
67/04	・水素の不存在下における精製工程として溶剤抽出を包含するもの [3]	73/30	・電気的方法によるもの [3]
		73/32	・脱ろうの間に冷却する方法 [3]
		73/34	・制御または調整 [3]

73/36	・少量の油を含有する他の組成物，濃縮物または残渣からの石油ろうの回収；脱油，発汗 [3]
73/38	・石油ろうの化学的改質 [3]
73/40	・ろうまたは改質ろうの物理的处理，例．造粒，分散，乳化，照射 [3]
73/42	・石油ろうの精製 [3]
73/44	・水素または水素発生化合物の存在下で行なうもの [3]
75/00	炭化水素油の処理または変換用装置における腐食や汚れの防止一般（C10G7/10, C10G9/16 が優先） [6]
75/02	・腐食防止剤の添加によるもの [6]
75/04	・汚れ止め剤の添加によるもの [6]
99/00	このサブクラスの他のグループに分類されない主題事項 [8]
